

10/585461

JAP20 Rec'd PCT/PTO 07 JUL 2006

名称変更届

特許庁長官 殿

1. 国際出願の表示 PCT/JP2005/000070

2. 出願人

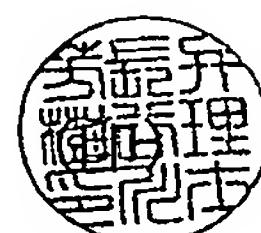
名 称 日立化成工業株式会社
HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
あ て 名 〒163-0449 日本国東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
1-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0449 Japan
国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

3. 名称を変更した者

事件との関係 出願人
旧名称 日立化成工業株式会社
HITACHI CHEMICAL CO., LTD.
新名称 日立化成工業株式会社
HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

4. 代理人

氏 名 (8815) 弁理士 長 谷 川 芳 樹
HASEGAWA Yoshiki
あて名 〒104-0061 日本国東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号
銀座ファーストビル 創英國際特許法律事務所
SOEI PATENT AND LAW FIRM
Ginza First Bldg., 10-6, Ginza 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan



107585461

JAP20 Rec'd PCT/PTO 07 JUL 2006

あて名変更届

特許庁長官 殿

1. 国際出願の表示 PCT/JP2005/000070

2. 出願人

名 称 日立化成工業株式会社
HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
あ て 名 〒163-0449 日本国東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
1-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0449 Japan
国 稷 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

3. あて名を変更した者

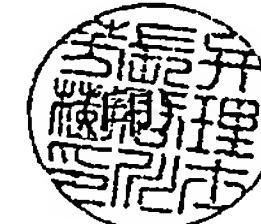
事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
氏 名 竹田津 潤 TAKETATSU Jun
旧あて名 〒308-8524 日本国茨城県下館市大字五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL CO, LTD.,
1150, Oaza Goshomiya, Shimodate-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
新あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
国 稷 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan

事件との関係	指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
氏 名	渡辺 伊津夫 WATANABE Itsuo
旧あて名	〒308-0866 日本国茨城県下館市大字五所宮 1150 番地 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL CO, LTD., 1150, Oaza Goshomiya, Shimodate-shi, Ibaraki 308-0866 Japan
新あて名	〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD., 1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
国 籍	日本国 Japan
住 所	日本国 Japan
事件との関係	指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
氏 名	後藤 泰史 GOTOU Yasushi
旧あて名	〒308-8524 日本国茨城県下館市大字五所宮 1150 番地 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL CO, LTD., 1150, Oaza Goshomiya, Shimodate-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
新あて名	〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD., 1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
国 籍	日本国 Japan
住 所	日本国 Japan
事件との関係	指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
氏 名	山口 一夫 YAMAGUCHI Kazuo
旧あて名	〒308-8521 日本国茨城県下館市大字小川 1500 番地 日立化成工業株式会社 総合研究所内 Research & Development Center, Hitachi Chemical Company, Ltd., 1500, Ogawa, Shimodate-shi, Ibaraki 308-8521 Japan
新あて名	〒308-8521 日本国茨城県筑西市小川 1500 番地 日立化成工業株式会社 先端材料研究所内 c/o Advanced Materials R&D Center, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD., 1500, Ogawa, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8521 Japan
国 籍	日本国 Japan
住 所	日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
 氏 名 藤井 正規 FUJII Masaki
 旧あて名 〒308-8524 日本国茨城県下館市大字五所宮 1150 番地
 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL CO, LTD.,
 1150, Oaza Goshomiya, Shimodate-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
 新あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
 日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
 c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
 1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan
 国 籍 日本国 Japan
 住 所 日本国 Japan

4. 代理人

氏 名 (8815) 弁理士 長谷川 芳樹 HASEGAWA Yoshiki
 あて名 〒104-0061 日本国東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号
 銀座ファーストビル 創英國際特許法律事務所
 SOEI PATENT AND LAW FIRM
 Ginza First Bldg., 10-6, Ginza 1-chome,
 Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan



10/585461

JAP20 Rec'd PCT/PTO 07 JUL 2006

名義変更届

特許庁長官 殿

1. 國際出願の表示 PCT/JP2005/000070

2. 出願人

名 称 日立化成工業株式会社
HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
あ て 名 〒163-0449 日本国東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
1-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0449 Japan
国 稽 本國 Japan
住 所 日本国 Japan

3. 届け出の内容 新名義人

事件との関係 米国を除く全ての指定国における出願人
名 称 日立化成工業株式会社 HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.
あ て 名 〒163-0449 日本国東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
1-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0449 Japan
国 稽 本國 Japan
住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者

氏 名 竹田津 潤 TAKETATSU Jun

あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内

c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan

国 稽 本國 Japan
住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者

氏 名 渡辺 伊津夫 WATANABE Itsuo

あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan

国 籍 日本国 Japan

住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者

氏 名 後藤 泰史 GOTOU Yasush

あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan

国 籍 日本国 Japan

住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者

氏 名 山口 一夫 YAMAGUCHI Kazuo

あて名 〒308-8521 日本国茨城県筑西市小川 1500 番地
日立化成工業株式会社 先端材料研究所内
c/o Advanced Materials R&D Center, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1500, Ogawa, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8521 Japan

国 籍 日本国 Japan

住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者

氏 名 藤井 正規 FUJII Masaki

あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan

国 籍 日本国 Japan

住 所 日本国 Japan

事件との関係 指定国米国における出願人及びすべての指定国における発明者
氏 名 藤井 綾 FUJII Aya
あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市五所宮 1150 番地
国 籍 日本国 Japan
住 所 日本国 Japan
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内
c/o Goshomiya Works, HITACHI CHEMICAL COMPANY, LTD.,
1150, Goshomiya, Chikusei-shi, Ibaraki 308-8524 Japan

4. 代理人

氏 名 (8815) 弁理士 長谷川 芳樹
HASEGAWA Yoshiki
あて名 〒104-0061 日本国東京都中央区銀座一丁目 10 番 6 号
銀座ファーストビル 創英國際特許法律事務所
SOEI PATENT AND LAW FIRM
Ginza First Bldg., 10-6, Ginza 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-0061 Japan



5. 添付書類の目録

(1) 代理権を証明する書面 1 通

10/585461

JAP20 Rec'd 2006 JUL 07 2006

委任状

2006年6月1日

私儀 弁理士 長谷川 芳樹、同 寺崎 史朗を代理人と定めて、下記の権限を委任します。

1. 特許協力条約に基づく国際出願
「回路接続材料、これを用いたフィルム状回路接続材料、回路部材の接続構造及びその製造方法」
に関する一切の件
2. 上記出願および指定国の指定を取り下げる件
3. 上記出願についての国際予備審査の請求に関する一切の件並びに請求及び選択国の選択を取り下げる件

以上

あて名 〒308-8524 日本国茨城県筑西市
五所宮1150番地
日立化成工業株式会社 五所宮事業所内

氏名 藤井 綾

